

# 真空加熱炉・乾燥炉 PH225



## 真空加熱プロセス 真空バーク、真空乾燥炉として

ホットプレート加熱方式による高精度、高速加熱に対応。  
豊富なオプションにより、アプリケーションに合わせた真空加熱プロセスを構築いただけます。  
コントローラはタッチパネル式で、装置導入後、簡単に真空加熱プロセスをご使用いただけます。



### ◆仕様

	PH225-5415	PH225-1202	PH225-250	PH225-2002
最高温度	150℃	200℃	200℃	200℃
真空度	20pa			
プレートサイズ	550×400mm	120×120mm	Φ240mm	200×200mm
プレート材質	アルミ合金			
電源電圧	AC200V	AC200V または 100V	AC200V	AC200V または 100V
適合コントローラ	PCC118HV-TP			

	PH225-2403	PH225-3304	PH225-2406	PH225-2407
最高温度	300℃	400℃	600℃	700℃
真空度	20pa			
プレートサイズ	Φ240mm	Φ330mm	Φ240mm	Φ240mm
プレート材質	アルミ合金		インコネル合金	
電源電圧	AC200V			
適合コントローラ	PCC118HV-TP			

### ◆オプション

		カスタマイズ対応※
ウエハ	・リフター機構※ ・プロキシミティピン※ ・位置決めピン※	○
ガスフロー	・O <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> (N <sub>2</sub> 混合ガス)、その他(N <sub>2</sub> ガスは標準) ・石英ガラスベルジャー※ ・圧力コントロール※ ・マスフローコントロール(標準は手動流量バルブ)※	—
計器	・O <sub>2</sub> 濃度計 ・露点計 ・キャパシタマンメータ(ピラニー真空ゲージは標準)※	—
長時間運転対応	・水冷却ユニット	○
蒸発物トラップ	・冷却トラップユニット※	○

※ユーザー指定により製作対応致します

## タッチパネル式真空加熱コントローラ PCC118HV-TP



### PCC118HV-TP

### ◆仕様

タッチパネル	・カラー 10.4 インチ
モニター運動機能	・現温度 ・過昇温度、真空(101500 ~ 1Pa, ピラニゲージ値) ・O <sub>2</sub> 濃度(100% ~ 0.1ppm)※ ・露点※(+30 ~ -100℃) ・ガス流量(L/m, sccm) ・運転時レシピ条件 ・運転時間、残時間カウントダウン
レシピ設定	・10 レシピ, 15 ステップ ・温度 ・時間 ・ガスバルブ ・流量※ ・圧力※
データ収集	・CSV ファイル ・USB メモリ書き込み機能
安全機能	・過昇温設定、加熱時トビラロック、陽圧チェックバルブ ・チャンバ筐体温度監視 ・漏電 ・過電流 ・非常停止

※オプションにより構成